This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

L1 ANSWER 1 OF 1 WPIDS (C) 2002 THOMSON DERWENT

AN 1991-060915 [09] WPIDS

AB JP 03008709 A UPAB: 19930928

Compsn. is obtd. by reacting at least one cpd. selected from monoethanolamine, diethanolamine, mono-2-propanolamine, di-2-propanolamine, mono-3-3propanolamine and di-3-propanolamine, an alkoxysilane and water.

USE/ADVANTAGE - The compsn. can be used in forming silica films for insulation, surface protection and smoothing treatment of semiconductors and liquid crystal display elements and for protection of solid surfaces such as silion, glass, ceramics and metals. The coating liquid compsn. obtd.

has a very low gelling tendency.

In an example, to a test tube, 4.63~mmol of CH3Si(OCH3)3, 4.74~mmol of Si(OCH3)4, 28.1~mmol of water, 2~g of deuterated DMF and 80~mmol of diethanolamine were added. The test tube was sealed with a stopper, shakne vigorously and left to stand at room temperature The mixture remained in a

liquid
state and did not gel even after 2 months. The liquid obtd. was spin-coated on the surface of Si wafer and fired at 500 deg.C for 30 min to form a silica film. @(5pp Dwg.No.0/0)

⑩日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

@公開特許公報(A) 平3-8709

@Int.Cl.5

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)1月16日

C 01 B 33/12

С 6570-4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

塗布液用組成物 60発明の名称

> 頭 平1-143865 创特

識別記号

頭 平1(1989)6月6日 ②出

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業 個発 明者 松村 場内

東京都中央区日本檔室町2丁目2番1号 更レ株式会社

明細書

1. 発明の名称

盤布液用組成物

2. 特許請求の範囲

(1) モノエタノールアミン、ジエタノールアミ ン、モノー2ープロパノールアミン、ジー2ープ ロパノールアミン、モノー3ープロパノールアミ ンおよびジー3ープロパノールアミンから選ばれ **る少せくとも1つの化合物、アルコキシジランお** よび水とを反応することにより得られることを特 徴とする壁布液用組成物。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、シリカを含有した塗布液用組成物に 関する。特に、<u>半導体</u>、液晶裏示素子等の絶縁、 畏面保護、表面の凹凸の均一化等、並びにシリコ ン、ガラス、セラミックス、金属等の固体表面の 保護等を目的としたシリカ膜を形成するに際して 好遊に用いられる。

[従来の技術]

シリカ膜を形成する手段として、アルコキシシ ランの加水分解あるいは縮合生成物を基版に塗布 し、これを焼成する方法は旧くから知られている。 しかしながら、従来からのこの塗布液は、室温 で縮合が経時的に進行し、ゲル化するといった間 題点を有し、そのため、長期保存の点においても 問題があった。

[発明が解決しようとする課題]

木発明は、かかる従来技術の欠点を解消しよう とするものであり、経時的にゲル化の小さいシリ 力を含有した塗布液用組成物が提供される。

[課題を解決するための手段]

本発明は、上記目的を達成するために、下記の 構成を有する。

「モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、 モノー2ープロパノールアミン、ジー2ープロパ ノールアミン、モノー3-プロパノールアミンお よびジー3-プロパノールアミンから選ばれる少 なくとも1つの化合物、アルコキシシランおよび

する塗布液用組成物。」

本発明においては、モノエタノールアミン、ジェタノールアミン、モノー2ープロパノールアミン、ジー2ープロパノールアミン、モノー3ープロパノールアミンおよびジー3ープロパノールアミンから選ばれた少なくとも1種の化合物が用いられる。これらの化合物は、単独で用いても、また二種類以上の組合せを適宜選択して加えても良い。

本発明において用いられるアルコキシシランは 次の一般式(1)で表される。

(式中、R1、R2は、炭素数が1~6であるアルキル基、アリール基およびアルコキシアルキル 基から選ばれる置換基を示す。 & は1~4の整数 を、m、nはそれぞれ0~3の整数を示し、かつ、

キシシランおよび水の反応は無溶媒でも良いが、 通常溶媒の中で行なわれる。溶媒としては、有機 溶媒が好きしく、例えば、メタノール、エタノー ル、プロパノール、プタノール、ジェチレングリ コール、プロピレングリコール等のアルキレングリ コール、プロピレングリコール等のアルキレング リコール類: エチレングリコールモノメチルエー テル、エチレングリコールモノメチルエー テル、エチレングリコールモノメチルエー のエーテル類: ジメチルアセトアシビージメチル のケトン類: ジメチルアセトアシビージメチル のケトン類: ジメチルアセトアシビージメチル のケトン類: ジメチルアセトアシビーション・ ジメチルスルホキシド等を用いることができる。

次に反応条件について述べる。反応させる水の 量は、特に限定されるものではなく、アルコキシ シランの加水分解および/または総合反応率によって任意に変えることができるが、通常加水分解 および/または組合反応するアルコキシシランの 光~6倍モルの範囲で選択することが好ましい。

また本発明の 前記 アミノ 化合物の 量についても、 アルコキンドの種類、 添加物の 種類により 最遠認 4+m+n≤4を満たす。)

一般式(!)において、! あるいはmがそれぞれ2以上である場合、R!、R2は、それぞれ同様であってもよい。また、R!とR2とが同様であっても、異様であってもよい。

本発明においては、前記アミノ化合物、アルコ

加量は変わるものであり、特に限定はないが、アルコキシシテンに対し、1~10倍モルの範囲で 選択するのが好ましい。

溶媒の食も任意に選択可能であるが、通常アルコキシンテン100部当り、50~200部の範囲で選択するのが好ましい。

反応温度は、常温から反応系の沸点の範囲で通 ・常選択されるが、沸点以上の温度で加圧状態で反 応することももちろん差し支えない。

反応の様態は、連続式、バッチ式のいずれでも 良い。反応後必要に応じて、溶媒を追加し粘度を 国記すること、さらにポリメチルメタクリレート、 にドロキシセルローズ、ポリピニルアセタール等 の低温で分解しやすい重合体を粘度関節剤として 添加することも可能である。また? の。(C. R. の)。 ?。(CB, 0), 8。(CB, 0), 14。 Im (OCOCH1)。 Ti(OCOCH1)。等のガラス形成剤を、さらにドーパ ントとしてP。B。Sb。As。Zn。Au。 Pt、Ca、Sn等のアルコキン化合物。キレー ト化合物などの溶媒可溶の不純物を必要に応じて

罢 1

加えることも本発明において可能である。

[実施例] 実施例1

試験質に、CH₃Si(OCH₃)₃を4.6 3 mmol、Si (OCHs) a を4. 7 4 mmol、水 を 2 8 . 1 mol 、および重水業化<u>ジメチルフォル</u> ムアミド (DMF) 2g、ジエタノールアミンを 8 Quaol加えて、蓋をし良く振り混ぜて室温で放 置し、反応速度をプロトンNMRで測定するとと もに、系の状態の変化を観察した。この系のプロ トンNMRのシフトは次の通りである。

CH, Si (OCH,), фの (OCH,)

3. 45 ppm

Si (OCH1) 140 (OCH1) 3. 55 p p m

3. 45 (縮合の進行後) 0.05

CH, Si (OCH,), фОСН,

3, 25

CR, OH POCH,

、CH₃ Si (OCH₃) 3 中のCH₃ 基を基準 ▽ として、CH3 OHの生成量を定量して、表1に 示す結果を得た。

を観察した。

実施例1と同様に、CHgSi(OCHg)g 中のCH,甚を基準として、CH,OHの生成量 を定量して、表2に示す結果を得た。

来 2

反応時間()17)	4	2 8	5 2	7 6
CH,OH 生成量	6	20	2 3	2 7
(mmol)				
(OCH ₁) 甚の	18	60	70	8 2
反広率(%)		<u> </u>		
※の状態	液体	固体	固体	固体

この系ではメトキシ基の反応率が60%でゲル化、 固化した。

実施例2

温度計、撹拌機、冷却器を備えた200ml容 量の容器に、テトラプロポキシシラン 4 O mael、 およびメチルトリプロポキシシラン4 O zaol、イ

反応時間	251	i d b c	20 k r	60B
CH, OH 生成量	5	18	2 6	3 2
(mmol)				<u> </u>
(OCH1) 基の	1 5	5 5	7 9	9 9
反応率(%)	_			
系の状態	液体	液体	液体	液体

表1に示すとおり、この系の2ヵ月後のメトキ シ基の反応率は99%であったが、ゲル化せず浴 液状態を保った。

この2ヵ月後の溶液をシリコンウエハの上にス ピンコートし、500℃で30分間焼成してシリ カ膜を得た。この膜の厚さは 0. 8 μであった。 比较例1

実施例1において、DMF2g、ジエタノール アミン80amolに代えて、DMFを10g用いた 以外は、実施例1と同様にして、反応速度をプロ トンNMRに測定するとともに、系の状態の変化

オン交換水240anel、DMF100g、モノエ タノールアミン200mmalを加え退流条件で10 時間反応した。このようにして得た溶液を40℃ に加熱し、状態の変化を観察した。

得られた系を40℃に保って安定性を調べた。 3月後も溶液は液体状態で均一であった。

このようにして得た3カ月後の溶液をシリコン ウェハの上にスピンナーを用いて塗布し、500 ℃で熱処理した。膜厚約 0 . 7 μのシリカ膜を得 た。

比较例 2

実施例2において、DMF100g、モノエタ ノールアミン200amelに代えて、DMF200° gを用いた以下は、実施例2と同様の要領で反応 し、状態の変化を観察した。系の粘度は、徐々に **増大し、7日後には全体がゲル化した。**

実施例3

実施例2と同じ要領で、テトラエトキシシラン 4 O auci、メチルトリエトキシシラン4 O anel、 水240 mmol、DMF100 s、3 - プロパノー ルアミン240 meelを含む液を反応した。このようにして得た溶液を40℃で2カ月保管したが采はゲル化しなかった。合成後2カ月を経た溶液をシリコンウェハの上にスピンナーを用いて、500℃で熱処理した。腹厚約0.7μのシリカ膜を得た。

比较例3

実施例3において、DMF100g、3-プロパノールアミン240mmiに代えて、DMF150gを用いた以外は、実施例3と同様にして得た溶液を40℃で保管し、系の状態を観察した。系の粘度は徐々に増加し、3日後には系全体がゲル化した。

実施例4

温度計、撹拌器、冷却器を備えた200ml容 重の容器に、テトラエトキシシラン30mmoi、お よびフェニルトリメトキシシラン30mmoi、イオ ン交換水200mmoi、プロパノール50g、モノ エタノールアミン300mmoiを加え遠流条件で8 時間反応した。このようにして得た溶液を50℃

用いた以外は、実施例4と同様にして反応した。

このようにして得た溶液を40℃で2カ月保管したが系はゲル化しなかった。合成後2カ月を経た溶液をシリコンウエハの上にスピンナーを用いて、500℃で熱処理した。膜厚約0.7μのシリカ膜を得た。

比较例 5

実施例 5 において、ブタノール 5 0.g、モノー 2 ープロパノールアミン 3 0 0 anelに代えて、ブ タノールを 1 0 0 g 用いた以外は、実施例 5 と同 様にして得た溶液を 4 0 ℃で保管し、系の状態を 観察した。系の粘度は徐々に増加し、1 0 日以内 には系全体がゲル化し、固化した。

実施例 6

実施例4において、テトラエトキシシランをテトラプトキシシラン、フェニルトリメトキシンランに代えて、ジメチルジエトキシシラン、プロパノールに代えて酢酸エチル、モノエタノールアミンに代えて、ジー2ープロパノールアミンを用いた以外は、実施例4と同様にして反応した。

に加熱し、状態の変化を観察した。

得られた系を40℃に保って安定性を調べた。 2カ月後も溶液は液体状態で均一であった。

このようにして得た2ヵ月後の溶液をシリコンウェハの上にスピンナーを用いて塗布し、500℃で熱処理した。膜厚約0.6μのシリカ膜を得た

比较别 4

実施例4において、プロパノール50g、モノエタノールアミン300mmに代えて、DMFを100g用いた以外は、実施例4と同様にして得た溶液を40℃で保管し、系の状態を観察した。系の粘度は徐々に増加し、10日以内には系全体がゲル化し、固化した。

実施列5

実施例 4 において、テトラエトキシシランをテトラプロポキンシラン、フェニルトリメトキシシランに代えて、アチルトリエトキシシラン、プロパノールに代えてブタノール、モノエタノールアミンに代えて、モノー2 - プロパノールアミンを

このようにして得た溶液を40℃で2カ月保管 したが系はゲル化しなかった。合成後2カ月を経 た溶液をシリコンウェハの上にスピンナーを用い て、500℃で魚処理した。膜厚約0.8μのシ リカ膜を得た。

比较到6

実施例 5 において、酢酸エチル 5 0 g、 ジー 2 ープロパノールアミン 3 0 0 BB 0 i に代えて、酢酸エチルを 1 0 0 g 用いた以外は、実施 例 6 と同様にして得た溶液を 4 0 ℃で保管し、系の状態を観察した。系の粘度は徐々に増加し、1 0 日以内には系全体がゲル化し、固化した。

実施例7

実施例 4 において、フェニルトリメトキシシランに代えて、ジエチルジエトキシシラン、 プロパノールに代えてエチレングリコール、モノエタノールアミンに代えて、ジー2 ープロパノールアミンを用いた以外は、実施例 4 と同様にして反応し

このようにして得た溶液を40℃で2カ月保管

したが系はゲル化しなかった。合成後2カ月を廷 た溶液をシリコンウェハの上にスピンナーを用い て、500℃で熱処理した。原厚約0.7gのシ リカ源を得た。

比较例7

実施例でにおいて、エチレングリコール50g、 ジー2ープロパノールでミン300gaelに代えて、 エチレングリコールを100g用いた以外は、実 旋例でと同様にして得た溶液を40℃で保管し、 系の状態を観察した。系の粘度は徐々に増加し、 10日以内には系全体がゲル化し、固化した。 実施例8

実施例4において、フェニルトリメトキシシランに代えて、フェニルトリエトキシシラン、プロパノールに代えてジメチルスルホキシド、モノエタノールアミンに代えて、モノー3ープロパノールアミンを用いた以外は、実施例4と同様にして反応した。

このようにして得た溶液を40℃で2カ月保管 したが系はゲル化しなかった。合成後2カ月を経

た溶液をシリコンウエハの上にスピンナーを用いて、500℃で熱処理した。 膜厚約0.4μのシリカ膜を得た。

比較例9

実施例 9 において、ジエチレングリコール 5 0 g、ジー3 ープロパノールアミン 3 0 0 mmol に代えて、ジエチレングリコールを100g用いた以外は、実施例 9 と同様にして得た溶液を40℃で保管し、系の状態を観察した。系の粘度は徐々に増加し、10日以内には系全体がゲル化し、固化した。

実施例10

実施例4において、フェニルトリメトキシシランに代えて、ジエチルジエトキシシラン、プロパノールに代えてメトキシメタノール、モノエタノールアミンに代えて、ジー3ープロパノールアミンを用いた以外は、実施例4と同様にして反応し

このようにして得た溶液を40℃で2カ月保管 したが系はゲル化しなかった。合成後2カ月を逢

た溶液をシリコンウエハの上にスピンナーを用いて、500℃で熱処理した。凝厚約0.5μのシリカ限を得た。

出校野8

実施例8において、ジメチルスルホキシド50g、モノー3ープロパノールアミン300 assolに代えて、ジメチルスルホキシドを100g 周いた以外は、実施例8と同様にして得た溶液を40℃で保管し、系の状態を観察した。系の粘度は徐々に増加し、10日以内には系全体がゲル化し、図化した。

実施列9

実施例4において、フェニルトリメトキシシランに代えて、ジエチルジエトキシシラン、プロパノールに代えてジエチレングリコール、モノエタノールアミンに代えて、ジー3ープロパノールアミンを用いた以外は、実施例4と同様にして反応した。

このようにして得た溶液を40℃で2カ月保管 したが系はゲル化しなかった。合成後2カ月を経

た溶液をシリコンウエハの上にスピンナーを用いて、500で 然処理した。 膜厚約 0.8μ のシリカ膜を得た。

比较例10

実施例10において、ジェチレングリコール50g、ジー3ープロパノールアミン300 molに 代えて、ジェチレングリコールを100g用いた 以外は、実施例10と同様にして得た溶液を40℃で保管し、系の状態を観察した。系の粘度は徐々に増加し、10日以内には系全体がゲル化し、固化した。

[発明の効果]

本発明によって、ゲル化が扱めて少ない堕布 液用組成物を提供することができ、保存安定性な どにおいても、良好であるといった効果を有する。

特許出願人 東 レ 抹 式 会 社